

定制 Ptfе 耐腐蝕 6 英寸双把手光罩清洗花籃架

货号: PL-CP05



简介

高性能定制 PTFE 6

英寸双把手光罩清洗架，为半导体和实验室湿法工艺提供无与伦比的耐化学性。这些耐用的花篮确保样品处理安全、快速排水，并在强酸和溶剂中实现无污染清洗。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
半导体 RCA 清洗	硅晶圆在 SC-1 和 SC-2 溶液中依次浸泡，以去除有机和金属污染物。	对氧化剂和高温酸具有完全抗性，确保载具不降解。
光罩蚀刻	在使用强蚀刻剂去除层或其他遮光层期间固定 6 英寸光罩。	安全定位可防止光罩振动，确保高保真图形转移和零表面划伤。
太阳能电池制绒	使用 KOH 或 HF/HNO ₃ 混合物在硅表面创建微金字塔以提高光吸收的过程。	耐用的双把手设计允许在大批量、深槽工业环境中安全操作。
MEMS 与微流控	用于制造微机电系统的玻璃或硅基板的清洗和蚀刻。	材料纯度防止引入可能干扰微尺度器件功能的痕量杂质。
痕量分析实验室器皿	在专门的酸蒸汽清洗或浸泡期间固定烧杯、盖子或小部件。	保证无金属离子（无离子），使其成为超痕量元素分析支持的黄金标准。
导电玻璃预处理	用于 OLED 或钙钛矿太阳能电池研究的 ITO 或 FTO 涂层玻璃基板的清洗。	网格设计允许与导电层完全流体接触，同时保护基板边缘。
湿法显影	在光刻工作流程中，将涂有光刻胶并已曝光的晶圆传输通过显影液。	对各种有机显影液的化学稳定性确保结果一致且无材料相互作用。

参数	规格详情（型号：PL-CP05）
主要材料	100% 高纯原生聚四氟乙烯（PTFE）
基板兼容性	标准 6 英寸（152.4 mm）光罩、晶圆或玻璃
把手配置	双把手加强支撑，用于平衡垂直提升
耐温性	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学兼容性	通用（所有酸、碱、有机溶剂和食人鱼溶液）
槽位配置	可定制槽宽、节距和总容量（标准 10/25 槽）
结构特征	CNC 加工网格底座，用于快速排水；圆角样品接触点
表面光洁度	光滑、无孔的机加工 PTFE 表面（低摩擦）
把手高度	可定制以适应特定的清洗槽深度
金属含量	零（无金属结构）